2003

Доклады БГУИР апрель–июнь

Том 1, № 2

УДК 621.396.96.019

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОСТОЙКОСТИ МИКРОПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ ТЕРМОЦИКЛОВ И ТЕРМОУДАРА

Н.С. ОБРАЗЦОВ, С.Ю. МАКАРЕВИЧ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь

Поступила в редакцию 12 мая 2003

Описываются механизмы, приводящие к деградации электрофизических параметров микрополосковых линий при их ускоренных испытаниях на термостойкость. Предложена математическая модель изменения емкости микрополосковой линии под воздеиствием термоциклирования и термоудара.

Ключевые слова: микрополосковые линии, ускоренные испытания, термоциклирование, термоудар.

Введение

Оценка стабильности микрополосковых линий (МПЛ) с помощью выдержки при повышенной температуре требует большой длительности процедуры испытаний. Термоциклирование и термоудар представляют один из способов ускоренных испытаний изделий на термостойкость. Порядок и последовательность, а также интервал температур регламентированы ГОСТ. В электронной промышленности наибольшее распространение при испытаниях изделий электронной техники (ИЭТ) получил интервал температур от –60 до +125°C.

Циклическое воздействие температур (ЦВТ) в ИЭТ приводит к растрескиванию кристаллов, деформации покрытий, обрывам и коротким замыканиям, потери герметичности корпусов, ухудшению электрических характеристик.

Проведение термоциклирования исследуемых структур МПЛ в диапазоне температур $-65-+85^{\circ}$ С, соответствующих предельным температурам рабочего температурного диапазона СВЧ ГИС, по 2 мин при максимальном числе циклов, равном 80, не приводит к заметному изменению электрофизических параметров (емкости *C*, диэлектрической проницаемости ξ , проводимости ρ_0).

Однако платы с МПЛ, подвергнутые термоудару путем внесения в нагретую до $+260^{\circ}$ С кремнийорганическую жидкость на 1 мин нагрева на каждый цикл с охлаждением $\tau=1$ мин в условиях комнатной температуры приводят к возрастанию параметров, но имеют тенденцию к их уменьшению с увеличением числа циклов термоудара.

Изменение емкости *С* исследуемых структур МПЛ при всех описанных видах термовоздействий обусловлено протеканием процессов деградации не только многослойной металлизации МПЛ, а также на границе раздела металлизации с диэлектриком и в самом диэлектрике поликоровой подложки. В такой системе присутствуют также внутренние напряжения, стимулирующие протекания деградационных процессов под температурными воздействиями [1].

Методика проведения эксперимента

При определении диапазона температур термоциклирования и скорости изменения температуры в процессе термоцикла исходим из того, чтобы величина создаваемых внутренних напряжений, с одной стороны, не превышала предел прочности материала элементов полосковой линии и не вызывала катастрофических изменений, с другой стороны, ускоряла деградационные процессы. Кроме того, время нагрева и охлаждения структуры должно быть достаточным для нагрева всего объема материала конструкции, чтобы произошло изменение его линейных размеров и создание в ней внутренних механических напряжений. Отсутствие видимых изменений электрофизических характеристик полосковых линий при проведении термоциклирования в диапазоне температур –65–+85°С при времени нагрева и охлаждения 2 мин показывает, что за время термоцикла структура, очевидно, не успевает прогреться. Термоудар приводит к созданию в структуре больших градиентов температуры, а следовательно, и внутренних напряжений. Как следствие этого, наблюдается изменение свойств материалов и электрофизических характеристик полосковой линии.

Энергию активации *E_a* можно определить, применив следующий прием:

$$\ln C_i(T) = \ln K_c - E_a/kT, \qquad (1)$$

где K_c — коэффициент емкости; E_a — энергия активации; k — постоянная Больцмана; T — температура.

Представим $\ln K_c = b$; $-E_a/k = a$; $\ln C_j(T) = Y$; l/T = X. Тогда выражение (1) можно записать в виде линейной функции

$$Y = b + aX av{2}$$

Это означает, что, построив по результатам экспериментальных исследований зависимости вида

$$\ln C_j(T) = \varphi(l/T), \tag{3}$$

где ϕ — символ линейной функциональной связи, по их наклону (коэффициенту $a = -E_a/k$) можно определить энергию активации деградационного процесса.

Проводился анализ результатов температурных испытаний четырех выборок ГИС. Две выборки подвергались длительному воздействию температуры. Первая в течение 164 ч при T=+100°C (рис. 1), а затем в течение 1030 ч при T=+150°C (рис. 2), вторая выборка сразу подверглась воздействию температуры в течение 1030 ч при T=+150°C, т.е. без предварительной выдержки при T=+100°C (рис. 3).

Экспериментальная часть.

Из анализа экспериментальных данных следует вывод о том, что предварительная выдержка ГИС при T=+100°С практически не сказалась на характере изменения емкостей при дальнейшей выдержке ГИС в условиях температуры T=+150°С (рис. 4, 5). Поэтому есть основания предполагать, что энергия активации для диапазона температур +20–+100°С и температуры +150°С различна.

Разрабатывались модели экспоненциального вида, аппроксимирующие изменение значения емкостей ГИС при выдержке ГИС в условиях температуры $T=+150^{\circ}$ С в течение различных периодов времени.

Экспоненциальные модели изменения емкостей полосковой линии ГИС строились в виде выражений

$$C_i = \alpha \exp\left(-\beta t\right),$$

(4)

где C_j — значение *j*-й рассматриваемой емкости для текущего времени t; t — время выдержки в условиях температуры T=+150°C; α , β — константы, определяемые на основе экспериментальных данных.



Рис. 1. Изменение емкости МПЛ на начальном этапе воздействия температуры *T*=100°С в течение 150 ч







Рис. 3. Изменение емкости МПЛ на начальном этапе воздействия температуры T=150°C

Рис. 4. Изменение емкости МПЛ под воздействием температуры *T*=150°С



Рис. 5. Зависимость емкости МПЛ под воздействием температуры T=100°C в течение 164 ч и 150°C свыше 1000 ч

При построении моделей вида (4) коэффициенты α и β находились с помощью ЭВМ методом наименьших квадратов[3].

Поскольку (4) содержит два неизвестных коэффициента, то принять метод наименьших квадратов затруднительно. Для определения коэффициентов α и β использовался метод выравнивания зависимости (4). Логарифмируя уравнение (4), получим

 $\ln C_i = \ln \alpha - \beta t$.

Введем обозначения: $\ln C_i = Y$; $\ln \alpha = b$; $-\beta = a$; t = x.

Тогда выражение (5) запишется в виде

$$Y = b + aX \; .$$

Значения коэффициентов а и b определяются по формулам

$$a = K_{xy} / D_x; \ b = m_y - am_x, \tag{7}$$

(5)

(6)

где
$$m_x = \frac{\sum_{d=l}^n x_j}{n}; \ m_y = \frac{\sum_{d=l}^n y_j}{n}; \ K_{xy} = \frac{\sum_{d=l}^n (x_j - m_x)(y_j - m_y)}{n}; \ D_x = \frac{\sum_{d=l}^n (x_j - m_x)^2}{n};$$
 (8)

п — число экспериментальных точек.

Число экспериментальных точек *n* определялось числом дискретных моментов контроля значений емкостей С_i. Поскольку выборка исследуемых СВЧ ГИС была представлена несколькими экземплярами (образцами), то значение емкости С_i для каждой экспериментальной точки усреднялось. И эти значения использовались в дальнейшем для построения экспоненциальных моделей вида (5).

Для проведения процедуры проверки адекватности моделей можно оценить дисперсию емкости. Эта дисперсия будет обусловлена усреднением емкостей С_i для каждой экспериментальной точки, а также погрешностью измерения. Дисперсия D_{уср}, обусловленная усреднением емкости по всем испытываемым экземплярам, определена как среднее значение по трем наиболее заметным с точки зрения разброса емкости точкам. Для определения дисперсии, условленной погрешностью измерений, оценена предельная погрешность измерительного прибора типа Е7-12. Она составляет не более ±0,01пФ. В случае нормального распределения погрешностей измерений на основании правила "трех сигм" для дисперсии можно определить

$$D_{\vec{n}\vec{a}\vec{\delta}} = \frac{\delta^2(\tilde{N}_j)}{9},\tag{9}$$

где D_{norp} — дисперсия емкости, обусловленная неточностью измерения; $\delta(C_j)$ — абсолютное значение погрешности измерения емкости.

С учетом того что погрешности емкости, обусловленные усреднением (по нескольким испытываемым экземплярам) и неточностью измерения, независимы, для суммарной дисперсии емкости можно записать

$$D(C_j) = D_{\delta \bar{n}\delta} + D_{i\bar{n}\bar{a}\delta}$$
(10)

Значения $\delta(C_i) = \sqrt{D(C_i)}$, подсчитанные для рассматриваемых случаев, представлены

в таблице.

 $\delta(C_i) = \sqrt{D(C_i)}$ $D_{ycp}, \pi \Phi^2$ $D_{norp}, \pi \Phi^2$ Номер испытываемой партии 1 0,105×10⁻² 0,01 0,033 2 0,496×10⁻³ 0,01 0,023 0,121×10⁻² 3 0,01 0,035 4 0,153×10⁻² 0,039 0,01

Расчетные данные проверки адекватности модели

Проверка по критерию Фишера при значении доверительной вероятности 0,95 показывает, что построенные модели адекватны.

Доверительный интервал для значения емкости C_j в *i*-й точке

$$I_{j} = \left[\left(C_{j} \right) i - \Delta C_{j}; \left(C_{j} \right) i + \Delta C_{j} \right], \tag{11}$$

где ΔC_j — возможное отклонение емкости за счет действия случайных причин. Символ *i* при величине доверительного интервала подчеркивает тот факт, что величина доверительного интервала зависит от значения доверительной вероятности *j*. Величину ΔC_j определим в предположении, что ее распределение близко к нормальному:

$$\Delta C_j = t_j \,\,\delta(C_j),\tag{12}$$

где t_j — величина, показывающая, какое число среднеквадратичных отклонений $\delta(C_j)$ необходимо отложить вниз и вверх от экспериментального значения C_j , чтобы вероятность попадания теоретического значения емкости в этот диапазон была равна значению C_j . Из [2] известно, что

$$t_{j} = \arg \Phi^{*}(l + \gamma/2), \tag{13}$$

где Φ^* — стандартная функция нормального распределения.

Для доверительной вероятности γ =0,99 значение t_j =-2,56.

Значение величин ΔC_j для партии № 1 — 0,083 пФ, для партии № 2 — 0,058 пФ, для партии № 3 — 0,089 пФ, для партии № 1 — 0,100 пФ.

Используя значения ΔC_j , можно определить для каждой точки доверительные интервалы. Построив далее расчетный (по модели) график зависимости емкости C_j , посмотреть в какой степени он укладывается в доверительные границы.

Изменение емкости МПЛ обусловлено протеканием процессов деградации в многослойной металлизации, а также на границах раздела металлизации с диэлектриком и в самом диэлектрике. В используемой системе металлизации Сг–Си–Ni–Au нижний слой хрома обеспечивает адгезию к диэлектрической подложке. Слой меди является разделяющим (барьерным) слоем между адгезионным слоем хрома и проводящим слоем золота. Слой никеля выполняет технологические функции, обеспечивая хорошее сцепление между металлическими слоями, а также улучшенное качество соединения проволочного вывода с контактной площадкой. Рассматриваемая система находится в неравновесном состоянии, характеризуется контактом разнородных материалов и предполагает их взаимную диффузию, что приводит к образованию новых фаз. В такой системе присутствуют также внутренние напряжения, стимулирующие протекание деградационных процессов.

Повышение температуры приводит к увеличению средней энергии частиц (атомов) материала металлизации. Это приводит к повышению скорости процессов взаимной диффузии между металлическими слоями. Наиболее вероятным является взаимодействие между верхними слоями рассматриваемой системы металлизации, т.е. никелем и золотом.

Увеличение емкости исследуемых структур происходит в результате изменения диэлектрических свойств поликоровой подложки, а также границы раздела металл-диэлектрик. Увеличение емкости связано с протеканием диффузии материала металлизации в диэлектрическую подложку и уменьшением в результате этого суммарной толщины диэлектрика. Хром, используемый в качестве адгезионного слоя, является активным металлом, имеет высокое значение свободной энергии образования окисла и поэтому легко взаимодействует с диэлектриком на основе Al₂O₃.

Заключение

Проведена серия ускоренных экспериментов по оценке термостойкости микрополосковых линий.

Построена математическая модель изменения емкости микрополосковой линии под воздействием термоциклирования и термоудара.

Показано, что причиной отказа СВЧ ГИС является изменение частотных свойств МПЛ вследствие увеличения емкости исследуемых структур в результате изменения диэлектрических свойств поликоровой подложки, а также границы раздела металл–диэлектрик под влиянием термического воздействия.

RESEARCH OF A MICROSTRIPS THERMOSTABILITY AT AN OPERATION OF TEMPERATURE SHOCK AND TEMPERATURE CYCLING

N.S. OBRAZTSOV, S.YU. MAKAREVICH

Abstract

The mechanisms of physical properties degradation at accelerated tests of microstrips on a thermostability, under an operation of varying temperature are featured. The mathematical model of change of a microstrip's capacity under an operation of a temperature cycling and thermal shock is offered.

Литература

1. Образцов Н.С., Макаревич С.Ю. // Материалы II Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы проектирования и произодства радиоэлектронных средств". Т. 2. Новополоцк, 2002. С. 95–100.

2. *Бушминский И.П., Гудков А.Г., Дергачев В.Ф.* Конструкторское проектирование микросхем СВЧ. М., 1991.

3. Конструкторско-технологические основы проектирования полосковых микросхем / Под ред. И.П. Бушминского. М., 1987.